

中微半导体设备(上海)股份有限公司(证券简称:中微公司, 证券代码:688012)致力于为全球集成电路和LED芯片制造商提供领先的加工设备和工艺技术解决方案。中微公司开发的CCP高能等离子体和ICP低能等离子体刻蚀两大类、包括二十几种细分刻蚀设备已可以覆盖大多数刻蚀的应用。中微公司的等离子体刻蚀设备已被广泛应用于国内和国际一线客户, 从65纳米到3纳米及更先进工艺的众多刻蚀应用, 并已实现CMP湿法设备多种应用的覆盖。中微公司最近十年着重开发多种导体和半导体化学薄膜设备, 如MOCVD、LPCVD、ALD、PVD、PECVD和EPI设备, 并取得了可喜的进步。中微公司开发的用于LED和功率器件外延片生产的MOCVD设备早已在客户生产线上投入量产, 并在全球氮化镓基LED MOCVD设备市场占据领先地位。此外, 中微公司已全面布局光学和电子束量检测设备, 并开发多种泛半导体微观加工设备, 包括大平板显示设备等。这些设备都是制造各种微观器件的关键设备, 可加工和检测微米级和纳米级的各种器件。这些微观器件是现代数码产业的基础, 它们正在改变人类的生产方式和生活方式。在近五年的全球半导体设备客户满意度调查中, 中微公司总评分四次获得第三, 薄膜设备四次被评为第一。

愿景

中微公司致力于开发微观加工的半导体设备, 这些设备是数码时代的基础, 而数码时代改变了人类的生产方式和生活方式。

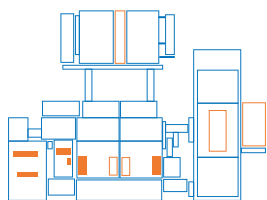
使命

中微公司致力于技术创新和产品的差异化; 致力于持续开发一系列微观加工的设备, 为客户和市场提供性能优越、高生产效率和性价比的设备解决方案; 并通过公司的持续发展回报股东和社会。

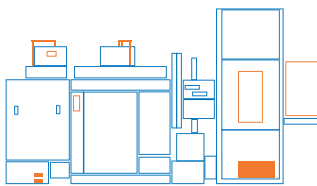


产品

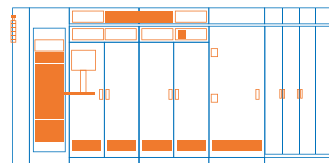
- 中微公司的等离子体刻蚀设备和硅通孔刻蚀设备已被广泛应用于国际一线客户, 覆盖诸多先进工艺的芯片加工制造及封装;
- 中微公司高度重视研发与创新, 在LPCVD、ALD、PVD、PECVD和EPI设备等领域取得诸多突破及进展;
- 中微公司开发的用于LED和功率器件外延片生产的MOCVD设备已在客户生产线上投入量产, 目前已在全球氮化镓基LED MOCVD设备市场占据优势地位。



等离子体刻蚀设备



薄膜设备等新产品



MOCVD设备

企业文化 & 发展战略

中微公司坚持“五个十大”的企业文化, 持续推进三维发展战略, 在集成电路、泛半导体设备领域深入创新, 在其他战略新兴领域, 聚焦环境保护设备的“中微惠创”、开发中小企业营运软件系统的“中微汇链”以及布局大健康领域的“芯汇康”都取得了良好进展, 共同推动公司实现高速、稳定、健康和安全的發展。

